

ПОЛЯРИЗАЦИОННО ЗАВИСЯЩАЯ ФОТОМАГНИТНАЯ ЭДС В КРИТИЧЕСКИХ ТОЧКАХ ЗОННОГО СПЕКТРА ГЕРМАНИЯ

Зыков В. Г., Сердега Б. К.

Экспериментально при 10–80 К исследована компонента фотомагнитной ЭДС в Ge, зависящая от поляризации возбуждаемого света. Обнаружено, что спектр фотоэдс состоит из нескольких полос, положения которых превосходно согласуются с энергиями межзонных вертикальных переходов E_0 , $E_0 + \Delta_0$, E_1 , $E_1 + \Delta_1$, их значения получены из независимых исследований электроотражения. Обсуждается модель формирования фотоэдс, базирующаяся на процессах оптического выстраивания импульсов электронов линейно поляризованным светом и их баллистического пролета в слое пространственного заряда.

1. Сведения о точном положении и характере структурных особенностей спектра энергетических зон (сингулярностей Ван Хова) чрезвычайно важны для интерпретации зонной структуры кристалла и связанных с ней электронных свойств материала. Проявление этих особенностей возможно в тех кинетических эффектах, где процессы переноса электронов в координационном пространстве сопровождаются их переходами в пространстве импульсов. Такие переходы, которые имеют место, например, между различными минимумами зоны проводимости, содержат информацию о соответствующих плотностях состояний и о форме изоэнергетических поверхностей минимумов. Информативными в этом смысле могут быть фотоэлектрические явления, наблюдать которые можно в широком спектральном диапазоне. Генерированные светом неравновесные электроны могут возбуждаться вертикальными переходами в различных точках пространства импульсов и в состояния зоны проводимости, начиная с ее абсолютного минимума и выше. Их вклад в явления переноса будет определяться плотностью состояний в точке возбуждения и временем жизни в этих состояниях. Если время установления регистрируемого эффекта меньше времени жизни электронов или сравнимо с ним в том или в другом состоянии, то в спектральной зависимости эффекта будут наблюдаться особенности, определяемые характеристиками состояний.

Наиболее приемлемым из такого типа явлений можно считать фотомагнитный эффект (ФМЭ) — явление, изученное наиболее детально во всех возможных условиях. Определяющим является то обстоятельство, что величина ЭДС ФМЭ чувствительна к междолинному перезаселению. Это установлено ранее для двух случаев перезаселения, вызванного диффузионно-дрейфовым переносом в пространстве [1] и селективной накачкой электронов в долинах зоны проводимости под действием линейно поляризованного света [2].

Немаловажным здесь является также и то свойство ЭДС ФМЭ, которое проявляется в образцах с приповерхностным слоем пространственного заряда, — возникновение дрейфовой компоненты фотоэдс. Время установления эффекта, полученное из оценок с учетом реальных величин поверхностных изгибов зон, находится в разумном соотношении с временем жизни электронов в возбужденных состояниях (временем релаксации импульса), что позволяет надеяться на появление связанных с ними особенностей в спектрах ЭДС ФМЭ.

В данной работе будет показано, что в образцах Ge спектр междолинной компоненты ЭДС ФМЭ, измеренный методом модуляции поляризации света, состоит из нескольких полос, энергетическое положение которых превосходно

согласуется с энергией межзонных переходов в критических точках электронного спектра, определенных из независимых исследований электроотражения (ЭО).

2. В качестве объекта исследований был выбран Ge прежде всего как материал, в котором энергетический спектр электронов в абсолютном минимуме зоны проводимости является многодолинным. В этом материале меньше, чем в других многодолинных полупроводниках, изучено явление селективного возбуждения электронов линейно поляризованным светом.

Для измерений использовались образцы, вырезанные из слитка слаболегированного Ge ($n \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$ при $T=300 \text{ K}$) и ориентированные относительно главных осей кристалла (рис. 1). После стандартной обработки образцы имели размеры $l_x \times l_y \times l_z$ [$10 \times 4 \times (0.1 \pm 0.2) \text{ мм}$]. Следует отметить особенности по-

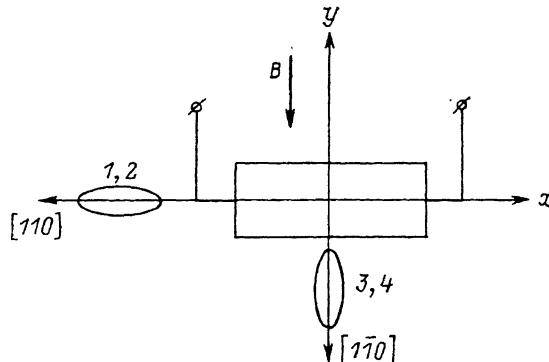


Рис. 1. Кристаллографическая ориентация образца.

Цифрами 1—4 пронумерованы проекции изоэнергетической поверхности L -диэнины на плоскость кристалла (100).

верхностной обработки образцов. Так как определяющим условием существования дрейфовой компоненты ЭДС ФМЭ является наличие пространственного заряда в поглощающем свет приповерхностном слое образца, необходимо было обеспечить соответствующий изгиб зон на его поверхности. Именно истощающий по отношению к основным носителям заряда изгиб зон на поверхности создавал такой знак приповерхностного электрического поля, при котором возникает аномальный фотоэффект [3]. Несмотря на то что общая амплитуда фотоэдс в этом случае меньше, чем в отсутствие изгиба зон, и с ростом последнего уменьшается вплоть до изменения знака (аномальная ЭДС ФМЭ), компонента, связанная с междолинным перезаселением, возрастает. Поэтому обеднение поверхности, которое происходит в результате применения травителей типа СР, было вполне уместным. Образующийся при этом поверхностный потенциал Ψ был достаточной величины ($\Psi e/kT \gg 1$) для наблюдения эффекта при низких температурах ($10 \div 80 \text{ K}$). Увеличение изгиба зон в случае необходимости достигалось предварительной термообработкой образца по методике [4], что, кстати, применимо только к материалам n -типа.

Толщина образца определялась удобством обращения, поскольку в условиях аномального фотоэффекта можно ее уменьшать вплоть до $l_z \geq w$ (w — толщина слоя пространственного заряда у освещаемой поверхности), что при прочих равных условиях приводит к увеличению значений фотоэдс из-за роста сопротивления.

Образец со стороны поверхности, параллельной осям xy , освещался поляризованным светом (рис. 1). Регистрация фотоэдс и ее фазы производилась селективным нановольтметром на частоте поляризационного модулятора 65 кГц. Поляризационная модуляция применялась для выделения зависящей от поляризации компоненты фотоэдс и заключалась в том, что электрическая компонента света e занимала периодически положения, параллельные осям x и y образца. Для этого использовался принцип модуляции, изложенный в [5], с некоторыми отличиями, а именно в пластинке-модуляторе из плавленого

кварца создается стоячая волна деформации сжатия—растяжения такой амплитуды, при которой в результате наведенного в ней двулучепреломления появляется сдвиг фаз в $1/4$ периода для данной длины волны. Свет с циркулярной поляризацией, создаваемой оптической системой из поляризатора и ромба Френнеля, проходя такую пластинку, становится линейно поляризованным с ориентацией e , связанной с пространственным положением пластиинки. При такой конфигурации оптической системы имеется возможность с помощью вращения пластиинки-модулятора вокруг оптической оси без изменения интенсивности света устанавливать пространственные положения крайних фаз плоскости поляризации, при которых селективное возбуждение либо существует ($e \parallel x, y$), либо нет. Причем в первом случае знак фотоэдс, регистрируемый синхронным детектором, должен меняться на противоположный при смене начальной ориентации $e \parallel x$ на $e \parallel y$.

Источником света служила галогенная лампа КГМ-150, обеспечивавшая с монохроматором МДР-4 постоянство интенсивности света на уровне 10^{15} кв/см 2 ·с.

Во избежание проявления квадратичных по магнитному полю эффектов его напряженность H устанавливалась такой, что всегда выполнялось условие $\mu H/c \leqslant 1$ (μ — биполярная подвижность).

3. Укажем прежде всего на принципиальную особенность используемой в работе поляризационной модуляции. Она заключается в том, что в отличие от ряда известных методов модуляционной спектроскопии, в которых при наличии внешнего воздействия на кристалл происходит перестройка электрон-

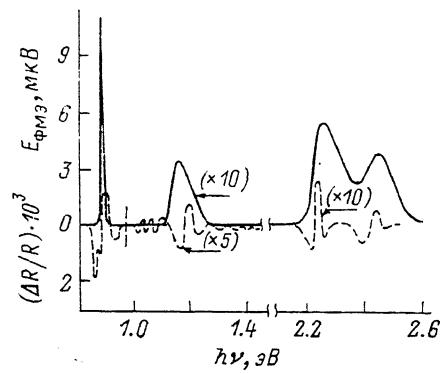


Рис. 2. Спектральная характеристика поляризационной компоненты фотомагнитной ЭДС (сплошная линия) в сравнении с приведенным из [12] спектром электроотражения (штриховая) ($T=10$ К).

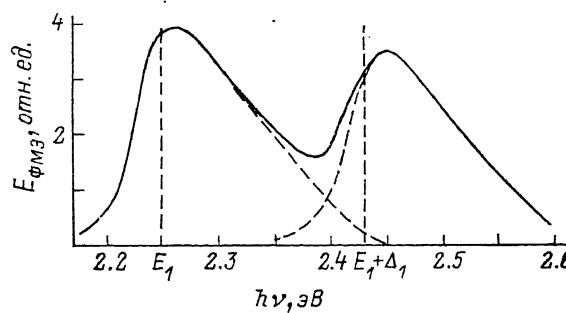


Рис. 3. Спектр поляризационной фотомагнитной ЭДС в области энергий дублета E_1 и $E_1 + \Delta_1$, значения которых взяты из [13].

ного спектра, здесь производится изменение одного из параметров самого воздействия. В данном случае, когда внешним воздействием является освещение образца, происходит периодическое изменение ориентации плоскости поляризации света.

Как всякое направленное воздействие, линейно поляризационный свет приводит в общем случае к образованию анизотропии электропроводности в полупроводниках кубической симметрии и возникновению связанных с нею некоторых фотоэлектрических эффектов [6]. Природа этой анизотропии обусловлена процессом оптического выстраивания импульсов (ОВИ) [7]. В многодолинных полупроводниках типа Ge разновидностью этого процесса является эффект селективного заселения эквивалентных минимумов зоны проводимости, расположенных в различных точках k -пространства.

Как уже отмечалось, при селективном возбуждении в долины зоны проводимости в образцах Ge, помещенных в магнитное поле, генерируется междолинная компонента ЭДС. Спектральная область существования эффекта, ограниченная пороговым значением энергии, с одной стороны, и процессом изотропизации функции распределения вследствие междолинных переходов — с другой, находится вблизи энергии вертикального перехода, т. е. у критической точки закона разностной дисперсии. Одной из таких точек в Ge может быть точка L , расположенная на краю зоны Бриллюэна в направлении λ .

Действительно, приведенный на рис. 2 спектр поляризационной компоненты ФМЭ содержит две полосы при энергиях 2.2—2.6 эВ, происхождение которых объясняется описываемой моделью. Основанием для такого вывода служит не столько то, что значения энергий совпадают с величинами, полученными при независимых измерениях, сколько форма кривых. Из рис. 3, где они приведены в масштабе, удобном для анализа, видно, что каждая из полос в отдельности обладает теми же характерными особенностями, что и спектральная зависимость степени селективного заселения для Si, приведенная в [8] и трактуемая однозначно. Так, общими у Ge и Si являются более крутой передний и пологий задний фронты, их расположение по отношению к значениям, взятым из [9], а также ширина запрещенной зоны E_1 и величина $E_1 + \Delta_1$, где Δ_1 — зазор между валентной и спин-орбитальной отщепленной зонами в определенной точке k -пространства.

Что же касается вопроса о местонахождении точки с отмеченными значениями энергии в зоне Бриллюэна, то полученные результаты могут способствовать разрешению существующей на этот счет неопределенности. Решающим аргументом в пользу нахождения сингулярности в точке L является наличие пологого спада заднего фронта как одной, так и другой полос (рис. 3). Такой спад, наблюдающийся на протяжении нескольких междолинных фононов ($LA=26$, $TO=35$ мэВ), обязан, согласно [10], процессу релаксации междолинного перезаселения посредством f -переходов. Этот спад в принципе не должен иметь места в модели параллельных зон, вытекающей из экспериментов по ЭО. Кроме того, общность формы у пика с энергией в максимуме 2.26 эВ и его спин-орбитального спутника позволяет сделать вывод также об общей критической точке для переходов $L_{4v}^- + L_{5v}^- \rightarrow L_{6c}^+$ и $L_{6c}^- \rightarrow L_{6c}^+$.

Полосы фотоэдс с энергиями 0.876 и 1.16 эВ (рис. 2) связаны с переходами в точке Γ , обозначаемыми E_0 и $E_0 + \Delta_0$ соответственно. Для такого вывода совпадения полос с линиями ЭО недостаточно. Так как полоса фотоэдс с линией E_0 находится на краю спектральной характеристики коэффициента поглощения в области максимальной ее крутизны, возможная неконтролируемая деформация кристалла и связанная с нею анизотропия оптических свойств смогут не только исказить истинное положение полосы, но и вообще стать основной причиной ее возникновения. Поэтому при проведении эксперимента были предприняты меры предосторожности, исключающие механическое воздействие на образец, а при анализе результатов учтены следующие обстоятельства: а) зависимость фотоэдс от ориентации плоскости поляризации описывается характерным для поляризационных эффектов законом $E_{\text{ФМЭ}} \sim \cos 2\varphi$, где φ — угол между e и осью x образца; б) изменения с температурой фотомагнитной ЭДС и времени междолинной релаксации имеют одинаковую тенденцию (возрастают с понижением температуры); в то же время биполярное время жизни, которое могло бы отражать концентрационную природу эффекта, увеличивается с ростом температуры; в) наблюдение методом электропоглощения линии E_0 осуществимо на образцах толщиной $d \approx 10$ мкм; использовавшиеся в данной работе образцы были толщиной $d \geq 100$ мкм, при которой исключалось изменение поглощаемой энергии света в диапазоне полосы E_0 вследствие возможной анизотропии коэффициента поглощения.

Эти и некоторые другие обстоятельства не оставляют сомнений в поляризационной природе анизотропных фотоэлектрических свойств. Вопрос состоит в другом: каким механизмом — процессом ОВИ в Г-долине или селективным заселением L -долин — создается анизотропия фотопроводимости. Несмотря на приведенные в [11] соображения о маловероятной поляризации перехода $L_{2s}^- \rightarrow L_1$ и изложенные в [9] в их подтверждение результаты эксперимента,

возможность селективного заселения L -долин не исключается прежде всего из-за неудачно выбранной длины волны используемого света ($\hbar\nu=0.83$ эВ).

Ответ на этот вопрос может быть получен при исследовании поляризационной компоненты ЭДС ФМЭ на образце, в котором оси x и y составляют угол 45° с осями [110], а крайние положения \mathbf{e} по-прежнему параллельны осям $5x$. В образце такой ориентации L -долины расположены симметрично по отношению к осям xy , вследствие чего исключается возможность проявления перезаселения между парами долин 1, 2 и 3, 4 в кинетических параметрах, определяющих фотоэффект. Результаты измерения фотоэдс на образце отмеченной ориентации приведены на рис. 4 (кривая 1) в сопоставлении со спектральной характеристикой образца с ориентацией, приведенной на рис. 1 (кривая 2). С учетом изложенных соображений, а также того, что вследствие сферичности Γ -долины в ней отсутствует ориентационная зависимость величины анизотропии, наведенной поляризованным светом, происхождение характеристики 1 следует связать исключительно с процессом ОВИ в Γ -долине.

Характеристика 2 (рис. 4) определяется совместным проявлением обоих механизмов образования анизотропии проводимости — как ОВИ в Γ -долине, так и селективным заселением L -долин. Несмотря на то что переход $\Gamma'_{25} \rightarrow L_1$ через промежуточное состояние Γ_2 является, согласно [9], неполяризованным, наблюдающееся в эксперименте селективное заселение может осуществляться переходами через промежуточные состояния в окрестности центра Γ'_2 -долины, где переходы разрешаются правилами отбора в высшем порядке.

Отметим, что некоспроизводимость поверхностного потенциала на различных образцах слабо влияла на амплитуду фотоэдс и практически не сказывалась на форме спектральных характеристик. Поэтому различие в положениях кривых 1 и 2 удается согласовать с моделью гофрированной валентной зоны, в которой масса плотности состояний различается в направлениях [100] и [110], вдоль которых ориентирован вектор \mathbf{e} в начальной фазе модуляции.

В заключение следует отметить, что наличие истощающего изгиба зон на поверхности образцов и связанного с ним поля пространственного заряда является одним из определяющих условий наблюдения отмеченных эффектов. Значения времен пролета электронов на длине поглощения под действием полей, которые получались в результате термообработки образцов, оказывались достаточными для существования баллистического тока. Эти времена много меньше не только времени междолинной релаксации, составляющей величину не более 10^{-9} с, но и времени релаксации импульса ($\sim 10^{-12}$ с). Подтверждением этого является результат использования дополнительной стационарной подсветки интенсивностью до 10^{16} кв/см²·с, которая во всех случаях приводит к спрямлению зон и практически к полному исчезновению сигналов поляризационной модуляции.

Таким образом, в работе установлено, что компонента ЭДС ФМЭ, зависящая от поляризации света, наблюдается в особых точках энергетического зонного спектра. Это свойство фотомагнитной ЭДС может быть использовано для исследования критических состояний, обладающего некоторыми преимуществами по сравнению с известными методами. В частности, поляризационная анизотропия фотоэффектов более чувствительна к характеристике точки сингулярности, поскольку на анизотропию возбуждения накладывается анизотропия электропроводности. Кроме того, значительная величина поляризационной компоненты ЭДС ФМЭ (ее доля составляла от 10^{-1} до $3 \cdot 10^{-3}$ в диапазоне температур $10 \div 80$ К) является сравнительно легко измеримой и при ис-

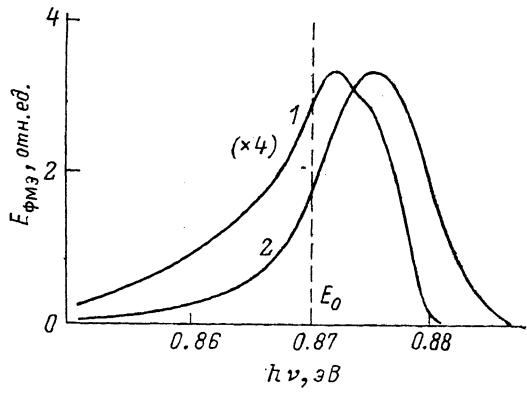


Рис. 4.
Объяснения в тексте.

пользовании ее для исследования эффектов селективной накачки как источника информации о различных релаксационных процессах.

Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность З. С. Грибникову, И. П. Жадько и В. А. Романову за полезные обсуждения экспериментальных результатов и ценные замечания.

Список литературы

- [1] Григорьев Н. Н., Зыков В. Г., Сердега Б. К., Шеховцов Л. В. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 10. С. 1764—1768.
- [2] Зыков В. Г., Сердега Б. К. // УФЖ. 1990. Т. 35. В. 5. С. 765—769.
- [3] Городецкий С. М., Жданович Н. С., Равич Ю. И. // ФТП. 1973. Т. 7. В. 7. С. 1270—1279.
- [4] Жадько И. П., Зинченко Э. А., Романов В. А., Сердега Б. К. // Физическая электроника. Львов, 1988. № 37. С. 75—78.
- [5] Jasperson S. N., Sahnatterleg S. E. // Rev. Sci. Instr. 1969. V. 40. N 6. P. 761.
- [6] Гальперин Ю. С., Коган Ш. М. // ЖЭТФ. 1969. Т. 56. В. 1. С. 355—361.
- [7] Земский В. И., Захарченя Б. П., Мирлин Д. Н. // Письма ЖЭТФ. 1976. Т. 24. В. 2. С. 96—99.
- [8] Гастев С. В., Соколов Н. С. // ФТП. 1985. Т. 19. В. 7. С. 1328—1334.
- [9] Соколов Н. С. // Оптические свойства полупроводников и вопросы обеспечения физических экспериментов. В. 1. Л., 1978.
- [10] Ефанов А. В., Энтин М. В. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 4. С. 662—669.
- [11] Kaplyanskii A. A., Sokolov N. S., Novikov B. V., Gastev S. V. // Sol. St. Commun. 1976. V. 20. P. 27—29.
- [12] Aspnes D. E. // Phys. Rev. B: Sol. St. 1975. V. 12. N 6. Т. 2297—2310.
- [13] Aspnes D. E. // Phys. Rev. Lett. 1973. V. 31. N 4. P. 230—234.

Институт полупроводников
АН УССР
Киев

Получена 4.06.1991
Принята к печати 15.07.1991